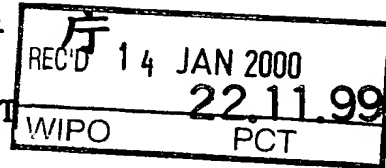


PCT/JP99/06502

日 本 国 特 許

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1998年11月24日

出 願 番 号

Application Number:

平成10年特許願第332782号

出 願 人

Applicant (s):

ダイキン工業株式会社

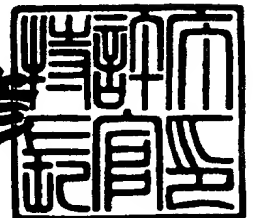
PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年12月24日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆彦



出証番号 出証特平11-3089658

【書類名】 特許願

【整理番号】 2928JP

【提出日】 平成10年11月24日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/306

【発明の名称】 エッチング液

【請求項の数】 16

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社
 淀川製作所内

 【氏名】 毛塚 健彦

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社
 淀川製作所内

 【氏名】 陶山 誠

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社
 淀川製作所内

 【氏名】 板野 充司

【特許出願人】

 【識別番号】 000002853

 【住所又は居所】 大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 1 2 号 梅田センタ
 ービル

 【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100065215

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 三枝 英二

 【電話番号】 06-203-0941

【選任した代理人】

【識別番号】 100076510

【弁理士】

【氏名又は名称】 掛樋 悠路

【選任した代理人】

【識別番号】 100086427

【弁理士】

【氏名又は名称】 小原 健志

【選任した代理人】

【識別番号】 100090066

【弁理士】

【氏名又は名称】 中川 博司

【選任した代理人】

【識別番号】 100094101

【弁理士】

【氏名又は名称】 館 泰光

【選任した代理人】

【識別番号】 100099988

【弁理士】

【氏名又は名称】 斎藤 健治

【選任した代理人】

【識別番号】 100105821

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100099911

【弁理士】

【氏名又は名称】 関 仁士

【選任した代理人】

【識別番号】 100108084

【弁理士】

【氏名又は名称】 中野 睦子

【選任した代理人】

【識別番号】 100109438

【弁理士】

【氏名又は名称】 大月 伸介

【選任した代理人】

【識別番号】 100109427

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 活人

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001616

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9706711

【ブルーフの要否】 要

【書類名】明細書

【発明の名称】エッチング液

【特許請求の範囲】

【請求項1】フッ化水素（HF）を含み、ボロンガラス膜（BSG）もしくはボロンリンガラス膜（BPSG）のエッチングレート／熱酸化膜（THOX）のエッチングレートが25℃で10以上であるエッチング液。

【請求項2】エッチング液の溶媒の比誘電率が6以下である請求項1記載のエッチング液。

【請求項3】有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種を含む請求項1に記載のエッチング液。

【請求項4】水及び有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種を含み、水の濃度が70重量%以下である請求項1に記載のエッチング液。

【請求項5】HF：イソプロピルアルコール：水の重量比が0.1～50重量%：30～99重量%：0～70重量%である請求項1に記載のエッチング液。

【請求項6】HF：酢酸：水の重量比が0.1～50重量%：30～99.9重量%：0～70重量%である請求項1に記載のエッチング液。

【請求項7】HF：テトラヒドロフラン：水の重量比が0.1～50重量%：30～99.9重量%：0～70重量%である請求項1に記載のエッチング液。

【請求項8】HF：アセトン：水の重量比が0.1～50重量%：30～99.9重量%：0～70重量%である請求項1に記載のエッチング液。

【請求項9】HF：メタノール：水の重量比が0.1～50重量%：30～99.9重量%：0～70重量%である請求項1に記載のエッチング液。

【請求項10】HF：エタノール：水の重量比が0.1～50重量%：30～99.9重量%：0～70重量%である請求項1に記載のエッチング液。

【請求項11】無機酸を含む請求項1に記載のエッチング液。

【請求項12】無機酸の25℃でのpKa値が2以下である請求項11に記載のエッチング液。

【請求項13】HF：HCl：水の重量比が0.01～50重量%：1～36

重量%：0～99重量%である請求項12に記載のエッチング液。

【請求項14】HF： HNO_3 ：水の重量比が0.01～50重量%：1～70重量%：0～99重量%である請求項12に記載のエッチング液。

【請求項15】請求項1～14のいずれかに記載のエッチング液を用いて被エッチング物をエッチング処理するエッチング処理物の製造方法。

【請求項16】請求項15の方法により得ることができるエッチング処理物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、エッチング液、エッチング処理物の製造方法及び該方法により得ることができるエッチング処理物に関し、より詳しくは、ドーブ酸化膜、特にBSG又はBPSGを非ドーブ酸化膜、特にTHOXに対して選択的にエッチングするエッチング液、エッチング処理物の製造方法及び該方法により得ることができるエッチング処理物に関する。

【0002】

【従来の技術及びその課題】

従来、シリコンウェハなどのエッチング剤は、HF（50重量%）と NH_4F （40重量%）を所望のエッチングレートになるように適当な割合で混合したバッファードフッ酸が用いられていた。

【0003】

しかしながら、バッファードフッ酸は、BSG、BPSG、リンガラス膜（PSG）、砒素ガラス膜（AsSG）などのドーブ酸化膜及びTEOS（テトラエトキシシランガスを用いたCVD法による酸化膜）等のUSG、THOXなどの非ドーブ酸化膜とともにエッチングするため、ドーブ酸化膜を選択的にエッチングすることはできなかった。

【0004】

本発明は、TEOS、THOXに対し不純物をドーブした酸化膜を選択的にエッチングするエッチング液及びエッチング方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明は、以下の項 1～項 16 に関する。

- 項 1. フッ化水素 (HF) を含み、ボロンガラス膜 (BSG) もしくはボロンリンガラス膜 (BPSG) のエッチングレート／熱酸化膜 (THOX) のエッチングレートが 25℃ で 10 以上であるエッチング液。
- 項 2. エッチング液の溶媒の比誘電率が 61 以下である項 1 記載のエッチング液。
- 項 3. 有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも 1 種を含む項 1 に記載のエッチング液。
- 項 4. 水及び有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも 1 種を含み、水の濃度が 70 重量％以下である項 1 に記載のエッチング液。
- 項 5. HF：イソプロピルアルコール：水の重量比が 0.1～50 重量％：30～99 重量％：0～70 重量％である項 1 に記載のエッチング液。
- 項 6. HF：酢酸：水の重量比が 0.1～50 重量％：30～99.9 重量％：0～70 重量％である項 1 に記載のエッチング液。
- 項 7. HF：テトラヒドロフラン：水の重量比が 0.1～50 重量％：30～99.9 重量％：0～70 重量％である項 1 に記載のエッチング液。
- 項 8. HF：アセトン：水の重量比が 0.1～50 重量％：30～99.9 重量％：0～70 重量％である項 1 に記載のエッチング液。
- 項 9. HF：メタノール：水の重量比が 0.1～50 重量％：30～99.9 重量％：0～70 重量％である項 1 に記載のエッチング液。
- 項 10. HF：エタノール：水の重量比が 0.1～50 重量％：30～99.9 重量％：0～70 重量％である項 1 に記載のエッチング液。
- 項 11. 無機酸を含む項 1 に記載のエッチング液。
- 項 12. 無機酸の 25℃ での pKa 値が 2 以下である項 11 に記載のエッチング液。
- 項 13. HF：HCl：水の重量比が 0.01～50 重量％：1～36 重量％：0～99 重量％である項 12 に記載のエッチング液。

項 14. HF : HNO₃ : 水の重量比が 0.01 ~ 50 重量% : 1 ~ 70 重量% : 0 ~ 99 重量% である項 12 に記載のエッチング液。

項 15. 項 1 ~ 14 のいずれかに記載のエッチング液を用いて被エッチング物をエッチング処理するエッチング処理物の製造方法。

項 16. 項 15 の方法により得ることができるエッチング処理物。

【0006】

【発明の実施の形態】

本発明のエッチング液は、BSG/THOX のエッチングレートもしくは BPSG/THOX のエッチングレートのいずれか一方あるいは両方が、25℃ で 10 以上、好ましくは 20 以上、より好ましくは 50 以上、特に 100 以上である。

【0007】

なお、THOX に代えて TEOS との比は、BSG/TEOS のエッチングレートもしくは BPSG/TEOS のエッチングレートのいずれか一方あるいは両方が、25℃ で 5 以上、好ましくは 10 以上、より好ましくは 50 以上、特に 100 以上である。

【0008】

本発明のエッチング液のエッチングレートは、本発明のエッチング液を用いて各膜 (BSG ; BPSG ; THOX ; TEOS 等の USG など) をエッチングし、エッチング前後での膜厚の差をエッチング時間で割って、計算により求めることができる。

【0009】

本明細書におけるエッチング液の比誘電率は、61 以下、好ましくは 50 以下、より好ましくは 30 以下である。エッチング液の比誘電率は、HF 及び無機酸以外のエッチング液の各成分の比誘電率を相加平均で表した値である。

【0010】

無機酸としては、好ましくは 25℃ での pKa 値が 2 以下の無機酸が挙げられ、例えば塩酸 (pKa = -8)、硝酸 (pKa = -1.8)、臭化水素酸 (pKa = -9)、ヨウ化水素酸 (pKa = -10)、過塩素酸 (pKa が測定できな

いほどの強酸)が例示される。

【0011】

有機酸としては、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸、カプリル酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、モノフルオロ酢酸、ジフルオロ酢酸、トリフルオロ酢酸、 α -クロロ酪酸、 β -クロロ酪酸、 γ -クロロ酪酸、乳酸、グリコール酸、ピルビン酸、グリオキサル酸、アクリル酸等のモノカルボン酸、メタンスルホン酸、トルエンスルホン酸等のスルホン酸、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、酒石酸、クエン酸等のポリカルボン酸が挙げられる。

【0012】

ヘテロ原子を有する有機溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール (IPA)、1-プロパノール、1-ブタノール、2-ブタノール、*t*-ブタノール、2-メチル-1-プロパノール、1-ペンタノール、1-ヘキサノール、1-ヘプタノール、4-ヘプタノール、1-オクタノール、1-ノニルアルコール、1-デカノール、1-ドデカノールなどのアルコール類；エチレングリコール。1, 2-プロパンジオール、プロピレングリコール、2, 3-ブタンジオール、グリセリンなどのポリオール類、アセトン、アセチルアセトン、メチルエチルケトン等のケトン類；アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル、イソブチロニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル類；ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒドなどのアルデヒド類；エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルなどのアルキレングリコールモノアルキルエーテル；テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、トリフルオロエタノール、ペンタフルオロプロパノール、2,2,3,3-テトラフルオロプロパノール等のフッ素アルコール、スルホラン、ニトロメタン等が挙げられる。

【0013】

HFの含有量は、0.01～50重量%程度、好ましくは1～5重量%程度である。

【0014】

水の含有量は、70重量%以下、好ましくは30重量%以下、より好ましくは0～5重量%程度である。

【0015】

無機酸の含有量は、1～99重量%程度、好ましくは30～70重量%程度である。

【0016】

有機酸の含有量は、30～99.9重量%程度、好ましくは70～99.9重量%程度である。

【0017】

ヘテロ原子を有する有機溶媒の含有量は、30～99.9重量%程度、好ましくは70～99.9重量%程度である。

【0018】

無機酸、有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種の含有量は、30～99.9重量%程度、好ましくは70～99.9重量%程度である。

【0019】

無機酸の25℃における pK_a は、約2以下、好ましくは約-5以下程度である。

【0020】

有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒の誘電率は、好ましくは約40以下、より好ましくは約10以下である。

【0021】

HFとしては、希フッ酸（50重量%水溶液）を通常用いるが、水を含まない場合には、100%HFを用いることもできる。同様にHCl、HBr、HIの場合には、これらのガスをエッチング液に吹き込むことにより無水のエッチング液を得ることができる。

【0022】

本発明の好ましいエッチング液及びその配合比を以下に示す。

・ HF : IPA : 水 = 1～10重量% : 70～99重量% : 0～30重量%

- ・ HF : 酢酸 : 水 = 0.5 ~ 5 重量% : 70 ~ 99.5 重量% : 0 ~ 30 重量%
- ・ HF : HCl : 水 = 0.01 ~ 5 重量% : 1 ~ 36 重量% : 50 ~ 99 重量%
- ・ HF : 硝酸 : 水 = 0.01 ~ 5 重量% : 1 ~ 70 重量% : 20 ~ 99 重量%
- ・ HF : 7-ヒト : 水 = 1 ~ 10 重量% : 70 ~ 99 重量% : 0 ~ 30 重量%
- ・ HF : THF : 水 = 1 ~ 10 重量% : 70 ~ 99 重量% : 0 ~ 30 重量%
- ・ HF : メタノール : 水 = 1 ~ 10 重量% : 70 ~ 99 重量% : 0 ~ 30 重量%
- ・ HF : エタノール : 水 = 1 ~ 10 重量% : 70 ~ 99 重量% : 0 ~ 30 重量%

本発明のエッチング液は、B、Pなどをドーブした酸化膜（BSG、BPSG等）及びTHOXやTEOS等の非ドーブ酸化膜を有する被エッチング物でドーブ酸化膜を選択的にエッチングするのに好適に使用できる。

【0023】

本発明のエッチング方法において、エッチング液の温度は15～40℃程度である。

【0024】

被エッチング物としては、シリコン単結晶ウェハ、ガリウム-砒素ウェハなどのウェハが挙げられ、特にドーブ酸化膜（BSG、BPSGなど）と非ドーブ酸化膜（THOX、TEOS等のUSG）を有する被エッチング物が好ましい。

【0025】

本発明のエッチング液のエッチングレートはBSGに対して通常10～200 nm/min程度、好ましくは40～500 nm/min程度である。

【0026】

【発明の効果】

本発明によれば、THOX、TEOS等のUSGに対しBSG、BPSGなどの不純物をドーブした膜を選択的にエッチングできるエッチング液、該エッチング液を用いたエッチング処理物の製造方法及びエッチング処理物を提供できる。

【0027】

【実施例】

以下、本発明を実施例および比較例を用いてより詳細に説明する。

実施例1～2及び比較例1～4（無機酸）

HF、水及びヘテロ原子を含む有機溶媒（イソプロピルアルコール（IPA）、THF、アセトン、メタノール、エタノール）、有機酸（酢酸）、無機酸（HCl、 HNO_3 ）を表1で表される割合で含んだエッチング液を調合し、シリコン基板上に熱酸化膜（THOX）、テトラエトキシシランガスを用いたCVD法によるUSG（TEOS）、ボロンガラス膜（BSG）、ボロンリンガラス膜（BPSG）を形成した試験基板に対するエッチングレート及び選択比を求めた。

【0028】

さらに、比較例として従来の $\text{HF}-\text{H}_2\text{O}$ のエッチング液及び $\text{HF}-\text{NH}_4\text{F}-\text{H}_2\text{O}$ のエッチング液を用い、同様にエッチングレート及び選択比を求めた。

【0029】

エッチングレートは、Rudolf Research 社 Auto EL-IIIエリプリメータを用いてエッチング前後の膜厚を測定することで行った。

【0030】

エッチング液のエッチングレートは、各エッチング液を25℃で各膜をエッチングし、エッチング前後での膜厚の差をエッチング時間で割って計算したものである。

【0031】

各組成での結果を、表1～表8に示す。

【0032】

なお、比誘電率は、溶媒（ヘテロ原子を含む有機溶媒または有機酸）+水の誘電率として25℃における溶媒の比誘電率と水の比誘電率の、その組成での平均値を計算値として示す。

比誘電率の平均値＝

$$\left[78.3 \times (\text{水の重量}\%) + (\text{溶媒の25℃での比誘電率}) \times (\text{溶媒の重量}\%) \right] / \left[(\text{水の重量}\%) + (\text{溶媒の重量}\%) \right]$$

【0033】

【表 1】

HF-H₂O-イソプロピルアルコール(IPA)のエッチャント

	溶媒名	溶媒の比 誘電率	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	溶媒(IPA) A)濃度 (%)	溶媒(IPA) +水の比誘 電率 (計算値)	THOX エッチングレ ート (A/分)	TEOS エッチングレ ート (A/分)	BSG エッチングレ ート (A/分)	BPSG エッチングレ ート (A/分)	BSG/T HOX濃 度比	BPSG/TH OX 濃度比	BSG/T EOS 濃度比	BPSG/TE OS 濃度比
実施例1	IPA	19.9	5	5	90	23.0	12	11	370	330	31	28	34	30
実施例2	IPA	19.9	5	25	70	35.3	55	76	920	1160	17	21	12	15
実施例3	IPA	19.9	5	45	50	47.6	97	140	1190	1650	12	17	8.5	12
実施例4	IPA	19.9	5	65	30	59.9	140	200	1450	1950	10	14	7.3	9.8
実施例5	IPA	19.9	3	3	94	21.7	2	3	120	-	60	-	40	-
実施例6	IPA	19.9	10	10	80	26.4	59	82	2200	-	37	-	27	-
実施例7	IPA	19.9	15	15	70	30.2	350	230	6500	-	28	-	19	-
実施例8	IPA	19.9	20	20	60	34.5	820	1200	12000	-	15	-	10	-
比較例1	(水)	(78.3)	1	99	0	-	58	93	380	-	6.5	-	4.1	-
比較例2	(水)	(78.3)	2	98	0	-	120	190	750	-	6.3	-	3.9	-
比較例3	(水)	(78.3)	5	95	0	-	300	490	1980	-	6.6	-	4.0	-

【0034】

【表 2】

HF-H₂O-酢酸のエッチャント

溶液名	溶液の比 酢酸率	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	溶液(酢 酸)濃度 (%)	溶液(酢酸) +水の比 電率 (計算値)	THOX エッチングレ ート (A/分)	TEOS エッチングレ ート (A/分)	BSG エッチングレ ート (A/分)	BPSG エッチングレ ート (A/分)	BSG/T HOX濃 度比	BPSG/TH OX 濃度比	BSG/T EOS 濃度比	BPSG/TE OS 濃度比
実施例9	酢酸	6.15	1	98	6.88	10	14	530	750	53	75	38	54
実施例10	酢酸	6.15	1.25	97.5	7.06	12	18	1200	940	100	78	67	52
実施例11	酢酸	6.15	1.5	97	7.25	17	22	1800	1300	94	76	73	59
実施例12	酢酸	6.15	2	96	7.62	25	33	2600	-	100	-	79	-
実施例13	酢酸	6.15	2.5	95	8	32	45	3800	-	110	-	80	-
実施例14	酢酸	6.15	3	94	8.38	40	55	4800	-	120	-	84	-
実施例15	酢酸	6.15	5	90	9.95	97	140	8900	-	92	-	84	-
実施例16	酢酸	6.15	5	93.75	9.80	18	23	1600	-	89	-	70	-
実施例17	酢酸	6.15	10	88.75	13.6	20	32	1300	-	66	-	41	-
実施例18	酢酸	6.15	20	78.75	20.8	32	46	970	-	30	-	21	-
実施例19	酢酸	6.15	30	68.75	28.1	39	58	830	-	21	-	14	-
実施例20	酢酸	6.15	40	58.75	35.4	40	65	670	-	17	-	10	-
実施例21	酢酸	6.15	50	48.75	42.7	43	72	590	-	14	-	8.2	-

【0035】

【表 3】

HF-H₂O-テトラヒドロフラン(THF)のエッチャント

	溶媒名	溶媒の比 誘電率	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	溶媒(T HF)濃 度 (%)	溶媒(THF) +水の比誘 電率 (計算値)	THOX エッチングレ ート (A/分)	TEOS エッチングレ ート (A/分)	BSG エッチングレ ート (A/分)	BPSG エッチングレ ート (A/分)	BSG/T HOX選 択比	BPSG/TH OX 選択比	BSG/T EOS 選択比	BPSG/TE OS 選択比
実施例22	THF	7.6	5	5	90	11.3	3	4	510	330	170	110	130	83
実施例23	THF	7.6	5	25	70	26.2	31	42	690	830	22	27	16	20
実施例24	THF	7.6	5	45	50	41.1	64	85	890	1200	14	19	10	14
実施例25	THF	7.6	5	65	30	56.0	110	150	1200	1600	11	15	8	11

【0036】

【表 4】

HF-H₂O-アセトンのエッチャント

	溶媒名	溶媒の 比誘電 率	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	溶媒(ア セトン)濃 度 (%)	溶媒(アセ トン)+水の 比誘電率 (計算値)	THOX エッチングレ ート (A/分)	TEOS エッチングレ ート (A/分)	BSG エッチングレ ート (A/分)	BPSG エッチングレ ート (A/分)	BSG/T H ₂ O濃 度比	BPSG/TH OX 濃度比	BSG/T EOS 濃度比	BPSG/TE OS 濃度比
実施例26	アセトン	20.7	5	5	90	23.7	3	4	410	250	140	83	100	63
実施例27	アセトン	20.7	5	25	70	35.9	24	29	440	520	18	22	15	18
実施例28	アセトン	20.7	5	45	50	48.0	49	67	620	780	13	16	9.3	11
実施例29	アセトン	20.7	5	65	30	60.1	96	140	960	1300	10	14	6.9	9.3

【0037】

【表 5】

HF-H₂O-メタノールのエッチャント

	溶媒名	溶媒の比 割合率	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	溶媒(メ タノール)濃 度 (%)	溶媒(メタノ ール)+水の比 割合率 (計算値)	THOX エッチングレ ート (A/分)	TEOS エッチングレ ート (A/分)	BSG エッチングレ ート (A/分)	BPSG エッチングレ ート (A/分)	BSG/T HOX濃 度比	BPSG/TH OX 濃度比	BSG/T EOS 濃度比	BPSG/TE OS 濃度比
実施例30	メタノール	32.6	3	3	94	34.0	0.5	7	44	73	88	150	6.3	10
実施例31	メタノール	32.6	5	5	90	35.0	3	9	170	230	57	77	19	28
実施例32	メタノール	32.6	10	10	80	39.9	22	43	730	410	33	19	17	9.5

【0038】

【表 6】

HF-H₂O-エタノールのエッチャント

	溶媒名	溶媒の比 割合	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	溶媒(エタ ノール)濃 度 (%)	溶媒(エタノール) +水の比 割合 (計算値)	THOX エッチングレ ート (A/分)	TEOS エッチングレ ート (A/分)	BSG エッチングレ ート (A/分)	BPSG エッチングレ ート (A/分)	BSG/T HOX濃 度比	BPSG/TH OX 濃度比	BSG/T EOS 濃度比	BPSG/TE OS 濃度比
実施例33	エタノール	24.6	5	5	90	27.4	7	9	250	210	36	30	28	23

【0039】

【表7】

HF-NH4F-H2Oのエッチャント(比較例)

	溶媒名	溶媒の比 誘電率	HF濃度 (%)	NH4F濃 度(%)	溶媒 (水)濃 度 (%)	THOX エッチングレ ート (A/分)	TEOS エッチングレ ート (A/分)	BSG エッチングレ ート (A/分)	BPSG エッチングレ ート (A/分)	BSG/T HOX濃 度比	BPSG/TH OX 濃度比	BSG/T EOS 濃度比	BPSG/TE OS 濃度比
比較例4	(水)	(78.3)	1	39.1	59.9	170	230	110	-	0.6	-	0.5	-
比較例5	(水)	(78.3)	2	2	96	280	480	620	-	2.2	-	1.3	-
比較例6	(水)	(78.3)	2	5	93	320	640	440	-	1.4	-	0.7	-
比較例7	(水)	(78.3)	2	10	88	400	700	350	-	0.9	-	0.5	-
比較例8	(水)	(78.3)	2	20	78	420	720	270	-	0.6	-	0.4	-
比較例9	(水)	(78.3)	2	30	68	390	610	230	-	0.6	-	0.4	-
比較例10	(水)	(78.3)	2	38.7	59.3	300	450	200	-	0.7	-	0.4	-

【0040】

【表 8】

HF-H₂O-酸添加のエッチャント

	添加酸 名	酸の pKa	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	酸添加 濃度 (%)	THOX エッチングレ ート (A/分)	TEOS エッチングレ ート (A/分)	BSG エッチングレ ート (A/分)	BPSG エッチングレ ート (A/分)	BSG/T HOX濃 度比	BPSG/TH OX 濃度比	BSG/T EOS 濃度比	BPSG/TE OS 濃度比
実施例34	HCl	-8	0.1	64	35.9	17	32	440	-	26	-	14	-
実施例35	HCl	-8	0.25	63.9	35.8	53	89	1200	-	23	-	13	-
実施例36	HCl	-8	0.5	63.9	35.6	120	200	2500	-	21	-	13	-
実施例37	HCl	-8	0.75	63.8	35.5	180	300	4300	-	24	-	14	-
実施例38	HCl	-8	1	63.7	35.3	240	380	4500	-	19	-	12	-
実施例39	HNO ₃	-1.8	1	30.4	68.6	240	340	5300	-	22	-	16	-
比較例11	H ₃ PO ₄	2.15 (pKa1) 7.20 (pKa2) 12.4 (pKa3)	1	15.7	83.3	120	170	850	-	8.7 7.1	-	5.9 5	-

【書類名】要約書

【要約】

【課題】不純物をドーブした酸化膜を選択的にエッチングする。

【解決手段】フッ化水素（HF）を含み、ボロンガラス膜（BSG）もしくはボロンリンガラス膜（BPSG）のエッチングレート／熱酸化膜（THOX）のエッチングレートが25℃で10以上であるエッチング液。

【選択図】なし

【書類名】 職権訂正データ
 【訂正書類】 特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】
 【識別番号】 000002853
 【住所又は居所】 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル
 【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社
 【代理人】 申請人
 【識別番号】 100065215
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル 三枝国際特許事務所
 【氏名又は名称】 三枝 英二
 【選任した代理人】
 【識別番号】 100076510
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル 三枝国際特許事務所
 【氏名又は名称】 掛樋 悠路
 【選任した代理人】
 【識別番号】 100086427
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル 三枝国際特許事務所
 【氏名又は名称】 小原 健志
 【選任した代理人】
 【識別番号】 100090066
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル 三枝国際特許事務所
 【氏名又は名称】 中川 博司
 【選任した代理人】
 【識別番号】 100094101
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル 三枝国際特許事務所
 【氏名又は名称】 館 泰光
 【選任した代理人】
 【識別番号】 100099988
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル 三枝国際特許事務所
 【氏名又は名称】 斎藤 健治

【選任した代理人】

【識別番号】 100105821

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜T
NKビル 三枝国際特許事務所

【氏名又は名称】 藤井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100099911

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜T
NKビル 三枝国際特許事務所

【氏名又は名称】 関 仁士

【選任した代理人】

【識別番号】 100108084

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜T
NKビル 三枝国際特許事務所

【氏名又は名称】 中野 睦子

【選任した代理人】

【識別番号】 100109438

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜T
NKビル 三枝国際特許事務所

【氏名又は名称】 大月 伸介

【選任した代理人】

【識別番号】 100109427

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜T
NKビル 三枝国際特許事務所

【氏名又は名称】 鈴木 活人

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002853]

1. 変更年月日	1990年 8月22日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル
氏 名	ダイキン工業株式会社